PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2003-103778

(43) Date of publication of application: 09.04.2003

(51)Int.CI.

2/045 B41J **B41J** 2/055

(21)Application number: 2001-298769

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

28.09.2001

(72)Inventor: KANEHARA SHIGERU

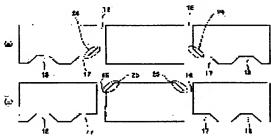
TANAKA MAKOTO YAMAGUCHI KIYOSHI

(54) INK-JET HEAD AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ink-jet head capable of preventing bubble generation by forming a communication hole between a pressuring liquid chamber and a nozzle by both dry etching and wet etching, and further providing an inclined part in a connection part between the pressuring liquid chamber and the communication hole, and also by providing an inclined part in the nozzle connecting surface of the communication hole, and to provide a production method therefor.

SOLUTION: An inclined part with the cross-section of the pressuring liquid chamber enlarged toward the communication hole is provided in a connection part between a pressuring liquid chamber and a communication hole in a pressuring liquid chamber forming member comprising the ink-jet head.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-103778 (P2003-103778A)

(43)公開日 平成15年4月9日(2003.4.9)

(51) Int.CL7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

B 4 1 J 2/045

2/055 2/16 B41J 3/04

103A 2C057

103H

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

(21) 出願番号 特顧2001-298769(P2001-298769) (22) 出顧日 平成13年9月28日(2001.9.28) (71)出版人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中屬込1丁目3番6号

(72)発明者 金原 滋

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72)発明者 田中 誠

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(74)代理人 100093920

弁理士 小島 俊郎

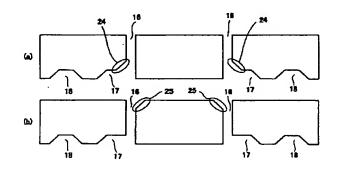
最終頁に絞く

(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッド及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 本発明は、加圧液室とノズルとの連通孔をドライエッチングとウェットエッチングの両工法で形成し、更に加圧液室と連通孔との接続部に傾斜部を設けることにより、気泡の発生を防ぐことが可能となると共に、連通孔のノズル接続面に傾斜部を設けることでも気泡の発生を防ぐことが可能となるインクジェットヘッド及びその製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明のインクジェットヘッドを形成する加圧液室形成部材における加圧液室と連通孔との接続部に、連通孔に近づくにつれて加圧液室の断面が大きくなる傾斜部が設けられている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のノズルを形成したノズル形成部材と、前記ノズルが連通する加圧液室形成部材と、電気機械変換素子の変位を前記インク変換液室に伝搬させるアクチュエータ部材とを備えたインクジェットヘッドにおいて、

前記加圧液室形成部材には、加圧液室と、該加圧液室と前記ノズルとを接続する連通孔とが少なくとも形成され、前記加圧液室形成部材における前記加圧液室と前記連通孔との接続部に、前記連通孔に近づくにつれて前記 10加圧液室の断面が大きくなる傾斜部が設けられていることを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項2】 複数のノズルを形成したノズル形成部材と、前記ノズルが連通する加圧液室形成部材と、電気機械変換素子の変位を前記インク変換液室に伝搬させるアクチュエータ部材とを備えたインクジェットヘッドにおいて、

前記加圧液室形成部材には、加圧液室と、該加圧液室と 前記ノズルとを接続する連通孔とが少なくとも形成され、前記加圧液室形成部材における前記連通孔と前記ノ ズルとの接合部に、前記ノズルに近づくにつれて前記連 通孔の径が大きくなる傾斜部が設けられていることを特 徴とするインクジェットヘッド。

【請求項3】 前記加圧液室形成部材はシリコンで形成されている請求項1又は2に記載のインクジェットヘッド。

【請求項4】 複数のノズルを形成したノズル形成部材と、前記ノズルが連通する加圧液室形成部材と、電気機械変換素子の変位を前記インク変換液室に伝搬させるアクチュエータ部材とを備えたインクジェットへッドを製造するインクジェットへッド製造方法において、

前記ノズルと連通する連通孔のパターンレジストのパターニングを行って作成されたレジストパターンに対するエッチングをドライエッチングにて基板を貫通させないように略平行四辺形の形状で行い、その後ウェットエッチングにて加工を行って前記連通孔のノズル側及び/又は前記インク変換液室側に傾斜部を形成することを特徴とするインクジェットヘッド製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はインクジェットへッド及びその製造方法に関し、詳細には結晶方位を有するシリコン単結晶基板に微細な形状を形成するための加工技術、特にインクジェットへッドに使用する液室部を構成するシリコン単結晶基板の加工技術及び加工形状に関する。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録装置は記録時の騒音 が極めて小さいこと、高速印字が可能なこと、インクの 自由度が高く安価な普通紙を使用できることなど多くの 利点を有する。この中でも記録の必要なときにのみイン ク液滴を吐出する、いわゆるインク・オン・デマンド方 式が記録に不要なインク液滴の回収を必要としないため 現在主流となっている。

【0003】このインク・オン・デマンド方式の従来の インクジェットヘッドとしては、特公平2-51734 号公報に提案されている駆動手段が圧電素子であるも の、特公昭61-59911号公報に提案されているイ ンクを加熱して気泡を発生させ、その圧力でインクを吐 出させる方法、特開平5-50601号公報に提案され ている駆動手段に静電気力を利用したものなどがある。 この中でもノズル開口が形成されたノズルプレートと振 動板とをスペーサの両面に接着して圧力室を形成し、振 動板を圧電振動子により変形させる形式のインクジェッ トヘッドは、インク滴を飛翔させるための駆動源として 熱エネルギーを使用しないから熱によるインクの変質が なく特に熱により劣化しやすいカラーインクを吐出させ ることが可能で、しかも圧電振動子の変異量を調整して インク滴のインク量を自在に調節することが可能である ため高品質なカラー印刷のためのプリンタを構成するの に最適なヘッドである。

【0004】一方、インクジェットヘッドを用いてより 品質の高いカラー印刷を行おうとすると一層高い解像度 が要求されるため、圧電振動子やスペーサ部材の隔壁等 のサイズが必然的に小さくなって、部材の加工や部材の 組み立てに高い精度が要求される。このため比較的簡単 な手法で微細な形状を高い精度で加工が可能なシリコン 単結晶基板の異方性エッチングを用いた部品製作技術、 いわゆるマイクロマシニング技術を適用してインクジェ ットヘッドを構成する部材を加工することが検討され、 種々な技術や手法が提案されている。ところで、高い品 質でカラー画像や文字を印刷しようとするとノズル開口 の配列密度を高めるばかりではなく一つのドット自体の 面積を画像信号に対応して変化させる印刷が要求され る。このためには一回のインク滴の吐出のインク量を少 なくし、かつ高速駆動を可能ならしめて一つのピクセル に対して複数回のインク滴の吐出ができるインクジェッ トヘッドを実現する必要がある。このためにはまず圧電 振動子の変位量を小さくし、かつ瞬時に圧力発生室の容 積変化として反映させることが必要となる。そして、圧 力発生室の小さな容積変化をインク滴の吐出に結びつけ るには圧力発生室内での圧力損失を小さくする必要があ る。圧電振動子の変位を効率よく圧力発生室の容積変化 に結びつけるためには圧力発生室の剛性を高めることが 重要であり、また圧力発生室での圧力損失を小さくする ためには圧力発生室の容積を小さくすることが重要な課 題となる。圧力発生室の容積を小さくするためには開口 面積を小さくすることが考えられるが、これに当接する 圧電振動子加工精度等を考慮するとせいぜいノズル開口 の配列ピッチ程度が限界となるから、結局のところ圧力

3

発生室の深さを浅くして容積を小さくする方法を採らざるを得ない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、一方で 組立工程などでのスペーサのハンドリングを考慮すると シリコン単結晶の厚みは300μm以上必要でこれより 薄いものでは強度が低くて組みたて工程時に破損が生じ るという問題がある。このため圧力発生室はシリコン単 結晶基板をその一方の面だけからエッチングする、いわ ゆるハーフエッチングを適用することによりシリコン単 10 結晶基板の厚みよりも浅く形成することが可能である。 しかしながら、他方でシリコン単結晶基板をスペーサに 用いる場合は圧力発生室に対向させてノズルプレートを 設け、ノズル開口と圧力発生室とを連通させるために圧 力発生室からノズルプレートが設けられる面に連通させ るための貫通部の形成が必要となる。ところが周知のよ うに異方性エッチングにより貫通部を形成するためには 少なくともシリコン単結晶基板の厚みの約1.7倍(√ 3)以上の開口長さを設定する必要があり、基板に30 0 μ m以上のものを用いると貫通部の最小長さは 5 1 0 μm程度となる。これでは連通孔の容積が圧力発生室の 容積の増加を引き起こすばかりではなくこの連通孔がシ リコン単結晶基板の厚み、つまり300μmでかつ長手 方向の長さが510 µmにもなるため高密度で圧力発生 室を配列した場合のように圧力発生室の隔壁を薄くせざ るを得ない場合には隔壁の剛性が低下してしまうという 問題がある。このような問題に対して連通孔の加工をウ ェットエッチング以外の工法、例えばレーザ加工やドラ イエッチングでの加工で行うことも考えられている。し かしながら、レーザ加工やドライエッチングでの加工で 30 は加工時間がかかってしまう。

【0006】本発明はこれらの問題点を解決するためのものであり、加圧液室とノズルとの連通孔をドライエッチングとウェットエッチングの両工法で形成し、更に加圧液室と連通孔との接続部に傾斜部を設けることにより、気泡の発生を防ぐことが可能となると共に、連通孔のノズル接続面に傾斜部を設けることでも気泡の発生を防ぐことが可能となるインクジェットヘッド及びその製造方法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】前記問題点を解決するために、本発明のインクジェットへッドは、複数のノズルを形成したノズル形成部材と、ノズルが連通する加圧液室形成部材と、電気機械変換素子の変位をインク変換液室に伝搬させるアクチュエータ部材とを備えており、加圧液室形成部材には、加圧液室と、加圧液室とノズルとを接続する連通孔とが少なくとも形成されている。更に、加圧液室形成部材における加圧液室と連通孔との接続部に、連通孔に近づくにつれて加圧液室の断面が大きくなる傾斜部が設けられている。よって、加圧液室から

連通孔にかけてのインクの流入が淀みなく行うことが可能で気泡発生によるノズルビット不良が生じない髙信頼性のインクジェットヘッドを提供することができる。

【0008】また、別の発明としてのインクジェットへッドによれば、加圧液室形成部材における連通孔とノズルとの接合部に、ノズルに近づくにつれて連通孔の径が大きくなる傾斜部が設けられている。よって、連通孔の端からノズル板にかけてのインクの流れが淀みなく行うことが可能で気泡発生によるノズルビット不良が生じない高信頼性のインクジェットヘッドを提供することができる。

【0009】更に、加圧液室形成部材はシリコンで形成されていることが望ましい。

【0010】また、他の発明としてインクジェットへッドの製造方法によれば、ノズルと連通する連通孔のパターンレジストのパターニングを行って作成されたレジストパターンに対するエッチングをドライエッチングにて基板を貫通させないように略平行四辺形の形状で行う工程と、その後異方性ウェットエッチングにて加工を行って連通孔のノズル側及び/又はインク変換液室側に傾斜部を形成する工程を有することに特徴がある。よって、ドライエッチングだけではスループットが悪くなるがウェットエッチングだけではスループットが悪くなるがウェットエッチングだけではスループットが悪くなるがウェットエッチングだけではスループットが悪くなるがウェットエッチングだけではスループットが悪くなるがウェットエッチングに併用することによりスループットが向上し、更に加圧液室と連通孔、及び/又は連通孔とノズル板へのインクの流れを淀みなく行うことが可能で気泡発生によるノズルビット不良が生じない高信頼性のインクジェットへッドを製造できるインクジェットへッド製造方法を提供することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明のインクジェットヘッドを 形成する加圧液室形成部材における加圧液室と連通孔と の接続部に、連通孔に近づくにつれて加圧液室の断面が 大きくなる傾斜部が設けられている。

[0012]

【実施例】図1は本発明の一実施例に係るインクジェットへッドの全体構成を示す分解斜視図である。同図において、本実施例のインクジェットへッドは、ノズル板11、流路板12、振動板13、アクチュエータ板14の各部品を含んで構成されている。

40 【0013】また、ノズル板11にはインク滴を飛翔させるための微細孔である多数のノズル15を各加圧液室の先端部分に対応して形成されており、このノズルの径は20~35μmである。このノズル板11は例えば電鋳工法によって製造したNiの金属プレートを用いているが、シリコンやその他金属材料を用いることができる。なおノズル板11には撥水性の表面処理膜を成膜している。

【0014】更に、流路板12はシリコンで形成されており、シリコン基板の面方位は(110)を使用している。この(110)基板を使用することにより、ノズルの

ピッチ方向に対して垂直に加圧液室を形成することができるため微細化、狭ピッチ化に有利となる。この流路板12には各ノズル孔15の連通する連通孔16、加圧液室17、共通液室18、共通液室18から加圧液室17へと連通する連通路(図示せず)が形成されている。各ノズル孔15へ連通する連通孔16は例えばドライエッチング法と異方性ウェットエッチング法により形成されている。加圧液室17及び共通液室18はSiの異方性ウェットエッチング法により形成されている。また、流路板12の表面には酸化膜が形成されている。酸化膜が10形成されていることで、インクに対して溶出しにくく、また濡れ性も向上するため気泡の滞留が生じにくい構造となる。これは酸化膜に限らず窒化チタン(TiN)膜、またはポリイミド膜でもかまわない。

5

【0015】また、振動板13はNi電鋳工法で形成した金属プレートからなり、この振動板13の振動機能部は、圧電素子内の非駆動部に接合する梁部19と、圧電素子内の駆動部と接合する島状凸部20と、この島状凸部20の周囲に形成した厚み3~10μm程度の最薄膜部分21(ダイヤフラム領域)とからなる。

【0016】更に、アクチュエータ板14はセラミック ス基板、例えばチタン酸バリウム、アルミナ、フォルス テライトなどの絶縁性の基板上に電気機械変換素子であ る複数の積層型圧電素子を列状に2列配列して接合し、 これら2列の各圧電素子をダイシングにより切断を行っ ている。なお、各列の複数の圧電素子はチャンネル方向 で駆動波形を印加する駆動部22と駆動波形を印加しな い非駆動部23を交互に構成している。ここで、圧電素 子は厚さ10~50μm/層のチタン酸ジルコン酸(P ZT)と厚さ数μm/層の銀パラジューム(AgPd) からなる内部電極とを交互に積層したものである。圧電 素子を厚さ10~50μm/層の積層型とすることによ って低電圧駆動を可能としている。なお、電気機械変換 素子としてPZTに限られるものではない。そして、こ の圧電素子の内部電極を交互に端面に取り出して端面電 極として一方基板上に共通電極パターン及び個別電極パ ターンを駆動部となる圧電素子の端面電極に導電性接着 削等を介して電気的に接続し、共通電極パターン及び共 通電極パターンに接続したFPCケーブルを介してPC B基板と接続して駆動部に駆動波形を印加することによ って積層方向の伸びの変位を発生させる。

【0017】図2は本実施例のインクジェットヘッドにおける流路板の構成を示す断面図である。同図において、図1と同じ参照符号は同じ構成要素を示す。図2の(a)に示す流路板は、共通液室18、加圧液室17、加圧液室とノズルとを連通する連通孔16とからなる。加圧液室17と連通孔16の繋ぎ部には連通孔16に近づくにつれて加圧液室17の断面が大きくなるように傾斜部24が設けられている。区のためインクの流れが淀まない構造となっている。図2の(b)に示す流路板

特開2003-103778 は、共通液室18、加圧液室17、加圧液室17とノズ ル15とを連通する連通孔16とからなる。連通孔16 のノズル接合面側にはノズルに近づくにつれて連通孔1 6の径が大きくなるように傾斜部25が設けられてい る。この傾斜部25の端上にノズル15を設けることに よりインクの流れが淀まない構造となっている。また、 気泡排出性の良い構造となっている。このため、高品 質、高信頼性のヘッドを形成することが可能である。 【0018】以下に別の発明であるインクジェットへッ ドの製造方法について説明する。図3は別の発明の第1 の実施例に係るインクジェットヘッドの製造工程を示す 断面図である。先ず、図3の(a)に示すように厚さ4 00 µmのシリコン基板(110)101を用意し、厚さ 1. 0 μ m のシリコン酸化膜 1 0 2 及び 0. 2 μ m の L P-CVD窒化膜103を形成した。次に、図3の (b) に示すように加圧液室のパターンにレジストのパ ターニングを行った。その後、レジストパターンにあわ せてシリコン窒化膜103のエッチング(A部分)を行 った。次に、図3の(c)に示すように、シリコン酸化 膜102をこの後の工程でSiを略100μmの深さま で掘るようにパターニング(B部分)を行った。その 後、図3の(d)に示すように連通孔のパターンレジス トのパターニングを行い、シリコン窒化膜103及びシ リコン酸化膜102を順にエッチング(C部分)を行っ た。このパターニングは後工程で異方性エッチングを行

に示すように水酸化カリウム水溶液によりエッチングを行い、加圧液室17の作成を行った。最後に、図3の(i)に示すようにシリコン窒化膜103及びシリコン酸化膜102の除去を行い、インクジェットヘッドの流路板の形成を行った。上記2度の異方性ウェットエッチングにより加圧液室17と連通孔16の連結部に傾斜部24が作成され、この傾斜部24によって気泡の滞留を防止して高信頼性のインクジェットヘッドを形成することができた。

うため、(111)面が出現するよう略平行四辺形の形状

で行った。次に、図3の(e)に示すようにA1のパタ

ーニングを行い、このAlをマスクにしてシリコンのドライエッチングを行い、連通孔の一部(D部分)の形成

去を行い、水酸化カリウム水溶液によりエッチングを行い、連通孔16を貫通させた。その後、図3の(g)に

示すようにシリコン窒化膜103をマスクにしてシリコ

ン酸化膜102の除去を行った。続いて、図3の(h)

30 を行った。その後、図3の(f)に示すように Alの除

【0019】図4は別の発明の第2の実施例に係るインクジェットヘッドの製造工程を示す断面図である。先ず、図4の(a)に示すように厚さ400 μ mのシリコン基板(110)101を用意し、厚さ1.0 μ mのシリコン酸化膜102及び0.2 μ mのLP-CVD窒化膜103を形成した。次に、図4の(b)に示すようにノズル面側に連通孔16の開口のためのウェットエッチン

グ用マスク用レジストパターンの形成を行った。その 後、レジストパターンにあわせてシリコン窒化膜103 及びシリコン酸化膜102のエッチング(A部分)を行 った。次に、図4の(c)に示すように加圧液室17の パターンにシリコン窒化膜103のパターニング(B部 分)を行った。その後、図4の(d)に示すように連通 孔16のパターンにレジストのパターニングを行い、シ リコン酸化膜102のエッチング(C部分)を行った。 このパターニングは後工程で異方性エッチングを行うた め、(111)面が出現するよう略平行四辺形の形状で行 10 った。次に、図4の(e)に示すようにA1のパターニ ングを行い、このAIをマスクにしてシリコンのドライ エッチングを行い、連通孔の一部(D部分)の形成を行 った。その後、図4の(f)に示すようにAlの除去を 行い、水酸化カリウム水溶液によりエッチングを行い、 連通孔16を貫通させた。その後、図4の(g)に示す ようにシリコン窒化膜103をマスクにしてシリコン酸 化膜102の除去を行い、加圧液室パターン用マスク (E部分)を形成した。続いて、図4の(h)に示すよ うに水酸化カリウム水溶液によりエッチングを行い、加 圧液室17の作成を行った。最後に、図4の(i)に示 すようにシリコン窒化膜103及びシリコン酸化膜10 2の除去を行い、インクジェットヘッドの流路板の形成 を行った。上記2度の異方性ウェットエッチングにより 連通孔16のノズル面側に傾斜部25を形成するように した。この後、傾斜部25の上部にノズル孔15を配置 することにより気泡の滞留を防止して高信頼性のインク ジェットヘッドを形成することができた。

【0020】図5は別の発明の第3の実施例に係るイン クジェットヘッドの製造工程を示す断面図である。先 ず、図5の(a)に示すように厚さ400μmのシリコ ン基板(110)101を用意し、厚さ1.0 µmのシリ コン酸化膜102及び0.2 μmのLP-CVD窒化膜 103を形成した。次に、図5の(b)に示すように加 圧液室のパターンにレジストのパターニングを行った。 その後、レジストパターンにあわせてシリコン窒化膜1 03のエッチング(A部分)を行った。次に、図5の (c) に示すようにシリコン酸化膜102をこの後の工 程でSiを略100μmの深さまで掘るようにパターニ ングを行った。その後、図5の(d), (e)に示すよ うに連通孔のパターンにレジストのパターニング(B部 分)を行い、シリコン窒化膜103及びシリコン酸化膜 102を順にエッチング(C部分)を行った。このパタ ーニングは後工程で異方性エッチングを行うため、(1) 11)面が出現するよう略平行四辺形の形状で行った。 次に、図5の(f)に示すようにAlのパターニングを 行い、このA 1をマスクにしてシリコンのドライエッチ ングを行い連通孔の一部(D部分)の形成を行った。そ の後、図5の(g)に示すようにAlの除去を行い、水 酸化カリウム水溶液によりエッチングを行い、連通孔1

6を貫通させた。その後、図5の(h)に示すようにシ リコン窒化膜103をマスクにしてシリコン酸化膜10 2の除去をして加圧液室用マスクパターン(E部分)の 形成を行った。続いて、図5の(i)に示すように水酸 化カリウム水溶液によりエッチングを行い、加圧液室1 7の作成を行った。最後に、図5の(j)に示すように シリコン窒化膜103及びシリコン酸化膜102の除去 を行い、インクジェットヘッドの流路板の形成を行っ た。本実施例ではノズル面側及び加圧液室側両面にイン クの流路を形成している。上下両面にインク流路を形成 することで加圧液室の高さを低くすることが可能でクロ ストークに対して影響を受けず、なおかつインク供給が マルチ駆動、髙周波駆動時でも十分可能となり髙品質の インクジェットを形成することが可能である。また、上 記2度の異方性ウェットエッチングにより加圧液室17 と連通孔16の連結部に傾斜部24が作成され、この傾 斜部24によって気泡の滞留を防止して高信頼性のイン クジェットヘッドを形成することができた。

【0021】なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲内の記載であれば多種の変形や置換可能であることは言うまでもない。

[0022]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のインクジェットへッドは、複数のノズルを形成したノズル形成部材と、ノズルが連通する加圧液室形成部材と、電気機械変換素子の変位をインク変換液室に伝搬させるアクチュエータ部材とを備えており、加圧液室形成部材には、加圧液室と、加圧液室とノズルとを接続する連通孔とが少なくとも形成されている。更に、加圧液室形成部材における加圧液室と連通孔との接続部に、連通孔に近づくにつれて加圧液室の断面が大きくなる傾斜部が設けられている。よって、加圧液室から連通孔にかけてのインクの流入が淀みなく行うことが可能で気泡発生によるノズルビット不良が生じない高信頼性のインクジェットへッドを提供することができる。

【0023】また、別の発明としてのインクジェットへッドによれば、加圧液室形成部材における連通孔とノズルとの接合部に、ノズルに近づくにつれて連通孔の径が大きくなる傾斜部が設けられている。よって、連通孔の端からノズル板にかけてのインクの流れが淀みなく行うことが可能で気泡発生によるノズルビット不良が生じない高信頼性のインクジェットヘッドを提供することができる。

【0024】更に、加圧液室形成部材はシリコンで形成されていることが望ましい。

【0025】また、他の発明としてインクジェットへッドの製造方法によれば、ノズルと連通する連通孔のパターンレジストのパターニングを行って作成されたレジストパターンに対するエッチングをドライエッチングにて基板を貫通させないように略平行四辺形の形状で行うエ

10

程と、その後異方性ウェットエッチングにて加工を行って連通孔のノズル側及び/又はインク変換液室側に傾斜部を形成する工程を有することに特徴がある。よって、ドライエッチングだけではスループットが悪くなるがウェットエッチングと併用することによりスループットが向上し、更に加圧液室と連通孔、及び/又は連通孔とノズル板へのインクの流れを淀みなく行うことが可能で気泡発生によるノズルビット不良が生じない高信頼性のインクジェットへッドを製造できるインクジェットへッド

9

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係るインクジェットヘッド の全体構成を示す分解斜視図である。

【図2】本実施例のインクジェットヘッドにおける流路*

* 板の構成を示す断面図である。

【図3】別の発明の第1の実施例に係るインクジェット ヘッドの製造工程を示す断面図である。

【図4】別の発明の第2の実施例に係るインクジェット ヘッドの製造工程を示す断面図である。

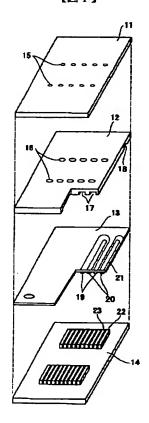
【図5】別の発明の第3の実施例に係るインクジェット ヘッドの製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

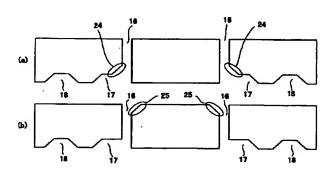
11;ノズル板、12;流路板、13;振動板、14; 10 アクチュエータ板、15;ノズル、16;連通孔、17;加圧液室、18;共通液室、19;梁部、20;島 状凸部、21;最薄膜部分、22;駆動部、23;非駆動部、24,25;傾斜部、101;シリコン基板、102;シリコン酸化膜、103;シリコン窒化膜。

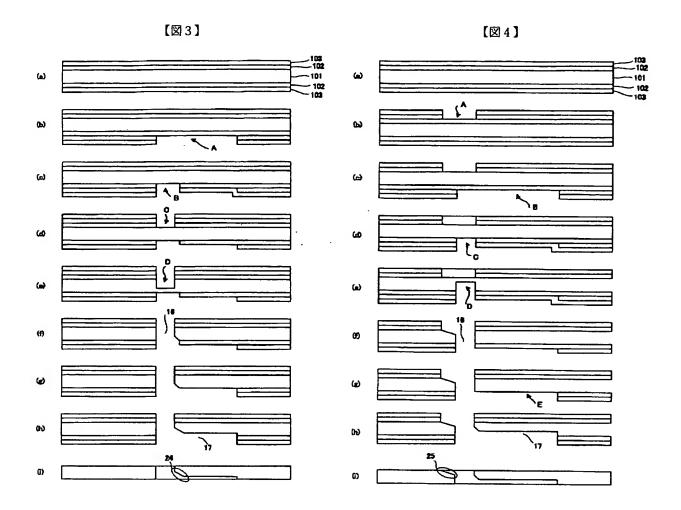
[図1]

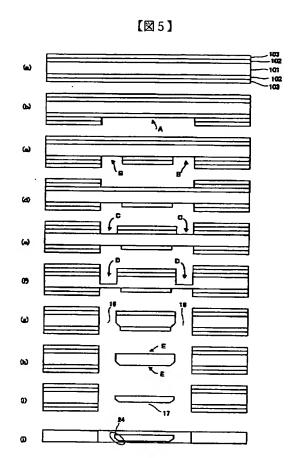
製造方法を提供することができる。



[図2]







フロントページの続き

(72)発明者 山口 清 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 F ターム(参考) 2C057 AF77 AG12 AG29 AP32 AP33 BA04 BA14